

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 04-263140

(43) Date of publication of application: 18.09.1992

.

(51) Int.CI. G11B 7/26

.....

(21) Application number: 03-037974

(71) Applicant: RICOH CO LTD

(22) Date of filing: 07.02.1991

(72) Inventor: MIZUTA OSAMU

(54) GLASS SUBSTRATE HAVING NON-REFLECTIVE COATING

(57) Abstract:

PURPOSE: To avoid the deformation and deterioration of an exposed groove by a method wherein a non-reflective coating layer which absorbs a light with a wavelength of an exposing light is provided on the lower surface of a glass plate to prevent the exposing light transmitted through a photoresist layer and a primer layer from being reflected by the glass plate.

CONSTITUTION: A primer agent layer 2 is applied to a glass plate 1, a photoresist layer 3 is applied to the layer 2 and, further, a non-reflective coating layer 6 is applied to the lower surface of the plate 1. After drying, a laser beam 5 is applied to expose the layer 3. A wide band multilayer reflection preventive film or the like which absorbs a light with a wavelength of the beam 5 is formed by a vacuum deposition method, a thermal deposition or the like as the layer 6. Even if a part of the beam 5 applied to the layer 3 through an object lens 4 is transmitted through the layer 3 and the layer 2 and enters the plate 1, the part of the beam 5 is absorbed by the layer 6 and a reflected returning light is not produced. With this construction, the deformation and deterioration of an exposed groove in the layer 3 caused by the reflected returning light can be avoided, so that a correct groove shape can be obtained.

(19)日本回答并介 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-263140

(43)公開日 平成4年(1992)9月18日

(51) Int.Cl.*

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示循所

G11B 7/26

7215 - 5 D

審査請求 未請求 請求項の数4(全 9 頁)

(21)出願番号

特願平3-37974

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

(22)出願日

平成3年(1991)2月7日

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 水田 治

東京都大田区中馬込一丁目3番6号 株式

会社リコー内

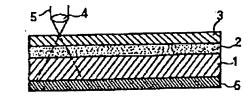
(54) 【発明の名称】 無反射コート付きガラス原盤

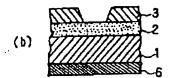
(57)【要約】

【目的】 ガラス板上のフォトレジストを露光する際に レーザ光がフォトレジスト等を透過しガラス板で反射す ることを防止してフォトレジストの露光溝に変形、劣化 が生じることを防止する。

【構成】 光ディスク用スタンパの製造に用いるガラス 原盤を構成するガラス基板1面に蘇光光源の波長を吸収 する材質から成る無反射コート層6を形成した。







(2)

特開平4-263140

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ディスク用スタンパの製造に用いるガ ラス原盤であって、該ガラス原盤はガラス板面に露光光 源の波長を吸収する材質から成る無反射コート層を備え ていることを特徴とする無反射コート付きガラス原盤。

【請求項2】 前記無反射コート層は前記ガラス板の上 面、即ち光源光を照射する露光面上に形成し、該無反射 コート層上にプライマー剤層と、フォトレジスト層を順 次積層したことを特徴とする請求項 1 記載の無反射コー ト付きガラス原盤。

【請求項3】 前記無反射コート層は前記ガラス板の底 面、即ち光澈光を照射する露光面とは反対側の面に形成 したことを特徴とする請求項1記載の無反射コート付き ガラス原盤。

【請求項4】 前記無反射コート層を前記ガラス板の上 面と底面に夫々直接形成したことを特徴とする請求項1 記載の無反射コート付きガラス原盤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はコンパクトディスク、光 20 ディスクの成形用金型としてのスタンパの製作に使用す るガラス原盤の改良に関する。

[0002]

【従来の技術】コンパクトディスク(CD)、レーザデ ィスク(LD)等のデジタル情報記録媒体、LPレコー ド等のアナログ情報記録媒体としての円盤状記録媒体を 成形する際に使用する従来のスタンパの電鍋加工方法に おいては、まずガラス原盤上に均一塗布したフォトレジ ストにレーザ等を照射して感光させてから現像すること により記録情報に応じた凹凸を有したプリフォーマット 30 パターンを得、このプリフォーマットパターン上に導体 化膜を形成する。続いて、この導体化膜を陰極としてN i電鋳を施してからガラス板を剥離してマスターを形成 し、このマスターに剥離皮膜処理を施した後でNi電鋳 を施すことによって得たNi層を剥離することによりマ ザーを作成する。更に、このマザーに剥離皮膜処理を施 した後でN | 電鋳を施すことによって0, 2~0, 4 m **/m程度の肉厚を有したスタンパ(サン)を得、このス** タンパを用いてプラスチックから成る上記記録媒体を成 形する。

【0003】図5 (a) は、従来のガラス原盤の構成を 示す断面図であり、このガラス原盤は、研磨したガラス 板1にプライマー剤2を塗布してその上にポジ型フォト レジスト3を塗布した構成を有する。これらの塗布方法 としては、スピンコート、ディップ、ペイパー等の手法 を用いる。プライマー剤2と、フォトレジスト3を塗布 した後はベーキングによって乾燥処理を施してから、光 源光を集光する対物レンズ4からAr+ レーザ5を照射 して露光を行っている。

ーザ光を照射した場合レーザ光の一部がフォトレジスト\ 3及びプライマー剤2を透過してガラス板1に漉し、ガ ラス板 1 からの戻り光がレジスト 3 に戻って来る。この ため、照射光によって感光された露光清部分を戻り光が 清の肩部を変形させてダレを起こした不良原盤となる。 同図 (b) の左側は戻り光がない場合の正常な清形状、 右側は戻り光がある場合の肩部のダレを起こした海形状 を夫々示す。不良原盤を用いて製作したマスター、マザ 一、スタンパ及びプラスチックディスクは夫々信号清形 10 状に異常を有した不良品となる。

[0005]

【発明の目的】本発明は上記に鑑みてなされたものであ り、ガラス板上のフォトレジストを露光する際にレーザ 光がフォトレジストを透過しガラス板で反射することを 防止してフォトレジストの露光溝に変形、劣化が生じる ことを防止したガラス原盤を提供することを目的として いる。

[0.006]

【発明の構成】上記の目的を達成する為本発明は、光デ ィスク用スタンパの製造に用いるガラス原盤であって、 該ガラス原盤はガラス板面に露光光源の波長を吸収する 材質から成る無反射コート層を備えていること、前記無 反射コート層は前記ガラス板の上面、即ち光源光を照射 する露光面上に形成し、該無反射コート層上にプライマ 一剤層と、フォトレジスト層を順次積層したこと、前記 無反射コート層は前記ガラス板の底面、即ち光源光を照 射する露光面とは反対側の面に形成すること、更には前 記無反射コート層を前記ガラス板の上面と底面に夫々直 接形成したことを特徴としている。

【0007】以下、添付図面に示した好的な実施例に基 づいて本発明を詳細に説明する。

【0008】図1 (a) は本発明の無反射コートを施し たガラス原盤の第1実施例の構成を示す縦断面図であ り、このガラス原盤は、研磨したガラス板1にプライマ 一剤2(材料としては例えば、HMD5等を用いる)を 塗布してその上にポジ型フォトレジスト3 (例えば. シ ップレー社 AZ-1350、東京応化OFPR-80 0 , その他)を塗布し、更にガラス板2の下面に無反射 コート6を盤布した構成を有する。これら各層2、3、 6 の塗布方法としては、スピンコート、ディップ、ペイ パー等の手法を用いる。プライマー剤層2と、フォトレ ジスト層3、無反射コート層6を塗布した後はペーキン グによって乾燥処理を施してから、光源光を集光する対 物レンズ4からAr+ レーザ等5を照射してフォトレジ スト層3を露光する。

【0009】無反射コート6としては、露光光5の波長 を吸収する材料を用いる。無反射コート材料には、Mg F2 (単層反射防止膜) と、誘電体多層膜(多層反射防 止膜)の2種類があり、誘電体多層膜には広帯域多層反 【0004】しかしながら上記構造のガラス原盤上にレ 50 射防止膜(マルチコート)と、狭帯域多層反射防止膜 (3)

3

(Vコート) がある。

【0010】上記各反射防止膜のうち先ずMgF2 単層 反射防止膜は安価で広帯域での使用が可能であるが反射 防止効果が比較的低い。広帯域多層反射防止膜は、可視 城での有効性が良好であり、強いレーザ光にも十分耐え る。被帯域多層反射防止膜は、紫外線、赤外レーザに有 効である。

【0011】本発明の用途には、広帯域多層反射防止膜 が最も適している。具体的なコーティング材料としては ら成る層と、 n = 1. 70の酸化ペリリウム又は酸化マ グネシウムからなる層を用いる。

【0012】次に、無反射コート層6として広帯域多層 反射防止膜を用いる場合には(1/4、1/4)コーテ ィング方法が一般的に用いられている。(1/4.1/ 4) コーティングは、低屈折率層と、高屈折率層との2 展構造であり、第1の層からの反射光が第2の層からの 弱めの反射光との間の干渉で総合的にキャンセルし合っ て反射光をなくすという原理を有する。

射されるレーザ光の1/4波長(λ/4)の光学厚さを 有する2つのコーティング層で構成されており、外側 (上側) の層にはガラス板よりも屈折率の低い材料が、 内側(下側)の層には高い屈折率の材料が夫々用いられ ている。高屈折率層での反射光B及びガラス板での反射 光Cの各位相は共に低屈折率層での反射光Aの位相と1 80度ずれている。

【0014】無反射コート層6の成膜方法としては、真 空蒸着法、熱蒸着法、ソフトフィルム法、電子衝撃法が あり真空蒸着法が一般的であるが、本実施例の無反射コ 30 ート層はいずれの方法に よって得たものであってもよ

【0015】以上のように本発明の第1の実施例におい ては、図1 (a) において対物レンズ4によってフォト レジスト3に向けて照射したレーザ光5の一部がフォト レジスト3、プライマー剤2を透過してガラス板1内に 入っても無反射コート層6で解消されて反射による戻り 光を生成することがないので、ガラス底面での反射戻り 光によってフォトレジストの露光清が変形、劣化するこ とがなくなり、図1(b)に示した如き正常な溝形状を 40得ることができる。

【0016】図3は本発明の第2実施例の縦断面図であ り、ガラス板1上面に直接無反射コート層6を塗布し、 無反射コート層 6 上にプライマー剤層 2 とフォトレジス ト層3を順次積層した構成を有する。この無反射コート 層6は図2で示した二層コートであり、鎖線下側の層6

aをMgF2、上側の槽6bを酸化ペリリウム又は酸化 マグネシウムとしている。対物レンズ4からのレーザ光 5は、フォトレジスト3、プライマー剤2を透過しても 無反射コート層6で解消され、ガラス板上面で反射する ことがないので、戻り光によってフォトレジストの算光 漬が変形、劣化することがなくなり、個1(b)に示し た如き正常な溝形状を得ることができる。

【0017】図6は本発明の第3実施例の縦断面図であ り、ガラス板1上下両面に夫々無反射コート層6、6を 二層コートの場合には屈折率 $\pi=1$. 38のMgF2か 10 塗布し、上方の無反射コート層6上にプライマー剤層2とフォトレジスト層3を順次積層した構成を有する。上 下の無反射コート層6、6は図3の実施例の無反射層コ ートと同様の二層コートである。対物レンズ4からのレ ーザ光5は、フォトレジスト3、プライマー剤2を透過 してもガラス板上面の無反射コート層6で反射すること がないので戻り光によってフォトレジストの母光清が変 形、劣化することがなくなり、図1(b)に示した如き 正常な溝形状を得ることができる。また、ガラス板下面 の無反射コート層 6 はレーザ光が万が一上方の無反射コ 【0013】このコーティング層は図2に示すように照 20 一ト層6を透過してガラス板1内に入射してもガラス板 底面での反射を防止することができる。

[0 0 1 8]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、ガラス板\ 上面又は底面、あるいは上下両面に露光光の波長を吸収 する材質の無反射コート層を強布したため、ガラス板上 のフォトレジストを露光する際にレーザ光がフォトレジ スト等を透過しガラス板で反射することを防止してフォ トレジストの露光溝に変形、劣化が生じることを防止す ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a) は本発明の第1実施例のガラス原盤の構成 を示す経断面図。(b) は本発明によって得られた露光溝 の形状を示す断面図である。

【図2】無反射コートの一例の特性を示す図。

【図3】本発明の第2の実施例のガラス原盤の構成を示 す縦断面図。

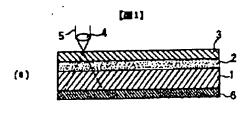
【図4】本発明の第3の実施例のガラス原盤の構成を示

【図 5】(a) は従来のガラス原盤の構成を示す縦断面 図、(b) は戻り光がある場合と無い場合の露光溝形状の 違いを示す図である。

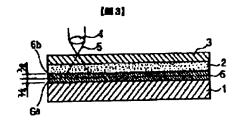
【符号の説明】

1・・・ガラス板、2・・・プライマー剤層、3・・・ フォトレジスト層、4・・・対物レンズ、5・・・露光 光(光源光)、6・・・無反射コート層

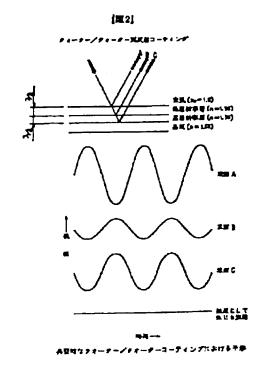
(4)



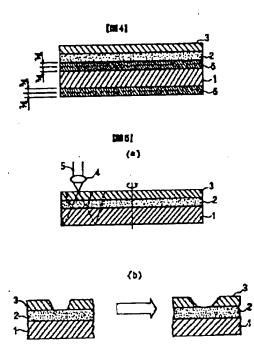




医程排号9009705



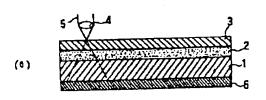
3002 9002706

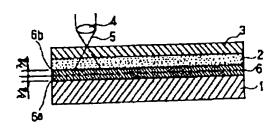


【手統補正書】 【提出日】平成3年12月5日 【手統補正1】 【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】全図 【補正方法】変更 【補正内容】







【図3】



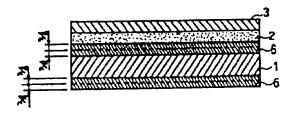
特開平4-263140

(6)

[図2]

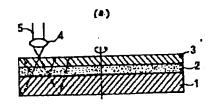
2年(April 1.6) 本現代学館 (April 1.6) 本現代学館 (April 1.6) 本現代本に試 本現代本に試 全現代本に試 を対象

[図4]

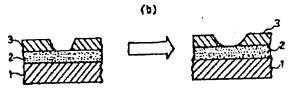


共型物なフォータープフォーターコーティングにおける干渉

4.5 【図5】



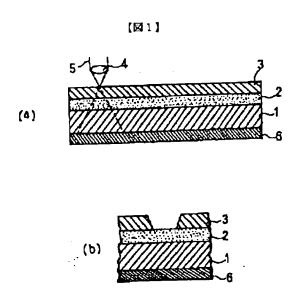


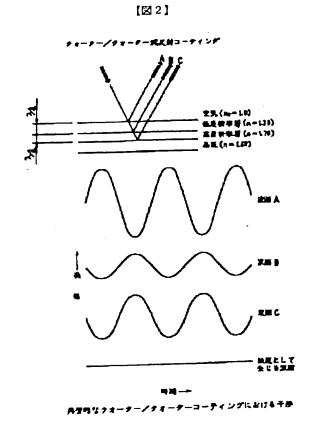


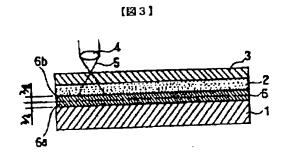
【手統補正書】 【提出日】平成4年4月1日 【手院補正1】 【補正対象書類名】図面

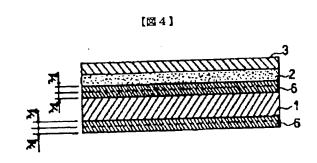
【補正対象項目名】全図 【補正方法】変更 【補正内容】 (7)

特開平4-263140





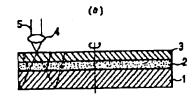




(8)

物類平4-263140

[2]5]



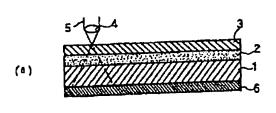
(b)

【手統補正書】 【提出日】平成4年5月1日 【手統補正1】 【補正対象書類名】図面

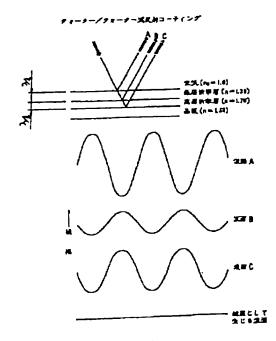
[図1]

【補正対象項目名】全図 【補正方法】変更 【補正内容】

[22 2]





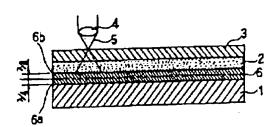


典型特別フォーアー/タオーターコーティングICEIJネモ港

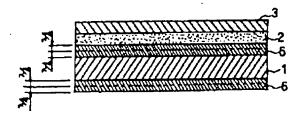
(9)

特開平4-263140

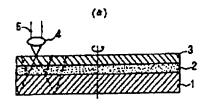




[図4]



[2]5]







}



